WHAT IS CLAIMED IS:

【請求項1】 ハロゲンを含む難燃性樹脂組成物を、前記樹脂組成物の熱 分解温度未満の温度で、脱ハロゲン化材料と脱ハロゲン化促進材料を含む 混合材料に接触させることを特徴とするハロゲンを含む難燃性樹脂組成物 の脱ハロゲン化処理方法。

【請求項2】 ハロゲンを含む難燃性熱硬化性樹脂組成物を、200℃以 上かつ前記熱硬化性樹脂組成物の熱分解温度未満の温度で、前記熱硬化性 樹脂における一部化学結合を分解し樹脂原料を生成する脱ハロゲン化促進 材料と、脱ハロゲン化材料を含む混合材料に接触させることを特徴とする ハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロゲン化処理方法。

【請求項3】 前記脱ハロゲン促進材料が、エチレングリコール、プロピ レングリコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、イソ プレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、 2-メトキシエタノール、2-エトキシエタノール、2-ジメトキシエタ ノール、2-イソプロポキシエタノール、2-ブトキシ エタノール、2 ーイソペンチルオキシエタノール、2ーヘキシルオキシエタノール、2ー フェノキシエタノール、2ーベンジルオキシエタノール、1ーメトキシー 2ープロパノール、1ーエトキシー2ープロパノール、ジエチレングリコ ールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジ エチレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメ チルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、トリエチレ ングリコールモノメチルエーテルおよびトリプロピレングリコールモノメ チルエーテル、テトラリン、ビフェニル、ナフタレン、1,4ーヒドロキ シナフタレン、ナフトール、1,4ーナフトキノン、ピッチ、クレオソー ト油、メチルイソブチルケトン、イソホロン、2-ヘキサノン、2-ヘプ タノン、4~ヘプタノン、ジイソブチルケトン、アセトニルアセトン、ホロン、シクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノンおよびアセトフェノンよりなる群から選択される少なくとも1種である請求項2に記載のハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロゲン化処理方法。

【請求項4】 ハロゲンを含む難燃性熱可塑性樹脂組成物を、前記熱可塑性樹脂組成物の熱分解温度未満の温度で、少なくともハロゲンを含む難燃剤を溶解する脱ハロゲン化促進材料と脱ハロゲン化材料を含む混合材料に接触させることを特徴とするハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロゲン化処理方法。

【請求項5】 前記脱ハロゲン化促進材料が、塩化メチル、ジクロロメタ ン、クロロホルム、四塩化炭素、ブロモホルム、メタノール、エタノール、 1ープロパノール、2ープロパノール、1ーブタノール、2ーブタノール、 イソブチルアルコール、tert-ブチルアルコール、フェノール、クレゾール、 エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、ジ プロピレングリコール、イソプレングリコール、トリエチレングリコール、 テトラエチレングリコール、ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒド ロフラン、アセトン、メチルエチルケトン、2-ヘキサノン、2-メチル -4-ペンタノン、ホロン、イソホロン、2-ヘプタノン、4-ヘプタノ ン、ジイソブチルケトン、アセトニルアセトン、シクロヘキサノン、メチ ルシクロヘキサノン、アセトフェノン、酢酸、アセトニトリル、ジエチル アミン、トリエチルアミン、N. N-ジメチルホルムアミド、N-メチル ピロリドン、ジメチルスルホキシド、2-メトキシエタノール、2-エト キシエタノール、2-ジメトキシエタノール、2-イソプロポキシエタノ ール、2-ブトキシエタノール、2-イソペンチルオキシエタノール、2 ーヘキシルオキシエタノール、2ーフェノキシエタノール、2ーベンジル

Mary Start Mary Starts

The state of the s

オキシエタノール、1ーメトキシー2ープロパノール、1ーエトキシー2ープロパノール、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ドリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールおよびテトラリンよりなる群から選択される少なくとも1種である請求項4に記載のハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロゲン化処理方法。

【請求項6】 ハロゲンを含む難燃性樹脂組成物を、前記樹脂組成物の熱分解温度未満の温度で、脱ハロゲン化材料と脱ハロゲン化促進材料を含む混合材料と、せん断力を加えて混練することにより接触させることを特徴とするハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロゲン化処理方法。

【請求項7】 前記せん断力を加えて混練することによる接触が、2軸混練機押出し機、ニーダ、または回転ロールによることを特徴とする請求項8に記載のハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロゲン化処理方法。

【請求項8】 前記脱ハロゲン化材料が、テトラリン、次亜りん酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、アスコルビン酸、ヒドラジン、ジイミド、ギ酸、アルデヒド、糖類、硫化水素、リチウム、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、チタン、水素化アルミニウムリチウム、水素化リチウム、水素化ジイソブチルアルミニウム、アルコール性カリ、金属アルコキシド、アミン、ヨウ化カリウムからなる群から選択される少なくとも1種である請求項1~7のいずれかに記載のハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロゲン化処理方法。

【請求項9】 前記ハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の前記混合材料への

接触が、前記混合材料の液相またはかつ気相との接触であることを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載のハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロゲン化処理方法。

【請求項10】 ハロゲンを含む難燃性樹脂組成物を、前記脱ハロゲン化 材料と脱ハロゲン化促進材料を含む混合材料に接触させることに先んじて、 接触雰囲気の酸素を排除する工程を有することを特徴とする請求項1~7 のいずれかに記載のハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロゲン化処理 方法。

【請求項11】 前記酸素を排除する工程が、窒素ガスを送気して前記雰囲気内の気体を窒素ガスに置換する置換工程及び/又は、排気により前記雰囲気内の気体を排出し減圧する減圧工程であることを特徴とする請求項10に記載のハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロゲン化処理方法。

【請求項12】 前記ハロゲンを含む難燃性樹脂組成物を、前記脱ハロゲン化材料と脱ハロゲン化促進材料を含む混合材料に接触させることにより発生する物質を、アルカリ溶液に通すことを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載のハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロゲン化処理方法。

【請求項13】 前記ハロゲンがデカブロモジフェニルエーテル、テトラブロモビスフェノールA、2,2ービス(4ーヒドロキシー3,5ージブロモフェニル)プロパン、ヘキサブロモベンゼン、トリス(2,3ージブロモプロピル)イソシアヌレート、2,2ービス(4ーヒドロキシエトキシー3,5ージブロモーフェニル)プロパン、パーフロロシクロデカンエチレンビス(ペンタブロモベンゼン)、エチレンビステトラブロモフタルイミド、ヘキサブロモシクロドデカン、含ハロゲンポリフォスフェート、塩素化パラフィン、ペンタブロムトルエン、オクタブロモジフェニルオキサイド、テトラブロモ無水フタル酸、臭素化(アルキル)フェノール、トリ

0

ス (トリブロモフェノキシ) トリアジン、臭素化ポリスチレン、オクタブロモトリメチルフェニルインダン、ペンタブロモベンジルアクリレート、ポリジブロモフェニレンオキサイド、ビス(トリブロモフェノキシエタン)、テトラブロモビスフェノール Aーエポキシオリゴマー/ポリマー、テトラブロモビスフェノール Aーカーボネートオリゴマー、テトラブロモビスフェノール Aービス (2, 3ージブロモプロピルエーテル)、テトラブロモビスフェノール Sでなる群から選ばれる少なくとも1つの化合物を構成していることを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載のハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロゲン化処理方法。

【請求項14】 前記ハロゲンを含む難燃性樹脂組成物が、少なくともガラス繊維の織布または不織布、ポリエステル繊維の織布または不織布、ナイロン繊維の織布または不織布、アクリル繊維の織布または不織布、アラミド繊維の織布または不織布、紙、マイカペーパ、綿布、アスベストから成る群から選択される少なくとも一つを基材を、エポキシ樹脂またはフェノール樹脂によって含浸してなるプリプレグを積層成形してなる樹脂積層品に、導体パターンを形成し、電子部品を装着したプリント回路板であることを特徴とする請求項2または3に記載のハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロゲン化処理方法。

【請求項15】 前記ハロゲンを含む難燃性樹脂組成物が、テレビ、ディスプレイまたはパーソナルコンピュータの筺体であり、脱ハロゲン化材料と脱ハロゲン化促進材料を含む混合材料に接触させることに先んじて、粉砕する工程を有することを特徴とする請求項4または5に記載のハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロゲン化処理方法。

【請求項16】 前記ハロゲンを含む難燃性樹脂組成物が、金属線を覆っ

てなるよう構成された複合物であり、前記脱ハロゲン化材料と脱ハロゲン 化促進材料を含む混合材料に接触させることにより、金属が分離される請 求項1~5のいずれかに記載のハロゲンを含む難燃性樹脂組成物の脱ハロ ゲン化処理方法。